

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日

2003年7月10日 (10.07.2003)



THERE CHANGE A CHAN COLO BALLERY IN COLO BALLERY CHAN CHAN CHAN COLO CHARGE COLO BALLERY

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/056380 A1

(51) 国際特許分類7:

PCT/JP02/13003

(21) 国際出願番号:

G02B 26/08, 26/02

(22) 国際出願日:

2002年12月12日(12.12.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2001-395511

2001年12月26日(26.12.2001) JP JP

2002年9月27日(27.09.2002) 特願2002-284190

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都 千代田区 丸の内三丁目 2番 3 号 Tokyo (JP). エ ヌティティエレクトロニクス株式会社 (NTT ELEC-TRONICS CORPORATION) [JP/JP]; 〒150-0043 東京 都 渋谷区 道玄坂一丁目 1 2 番 1 号 Tokyo (JP).

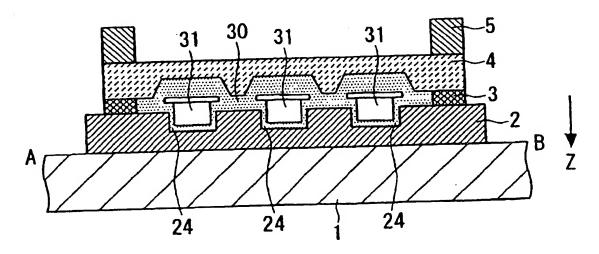
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 赤川 圭一 (AK-AGAWA, Keiich [JP/JP]; 〒100-8331 東京都 千代田区 丸の内三丁目 2番 3 号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 鈴木 美彦 (SUZUKI,Yoshihik)([JP/JP]; 〒100-8331 東 京都 千代田区 丸の内三丁目 2番3号 株式会社ニコン 内 Tokyo (JP). 石津谷 徹 (ISHIZUYA,Tohru) (JP/JP); 〒 100-8331 東京都 千代田区 丸の内三丁目 2番3号 株 式会社ニコン内 Tokyo (JP). 鈴木 純児 (SUZUKI,Jษฎ์i) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都 千代田区 丸の内三丁首 2番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 車田 克彦 (KURUMADA, Katsuhika) [JP/JP]; 〒150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂一丁目 12番1号 エヌティティエ レクトロニクス株式会社内 Tokyo (JP). 金谷 正敏 (KANAYA,Masatoski) [JP/JP]; 〒150-0043 東京都 渋谷 区 道玄坂一丁目 1~2番 1号 エヌティティエレクト ロニクス株式会社内 Tokyo (JP). 玉村 敏昭 (TAMA-MURA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒150-0043 東京都 渋谷区 道 玄坂一丁目 12番1号 エヌティティエレクトロニ クス株式会社内 Tokyo (JP).

/続葉有]

(54) Title: LIGHT BEAM SWITCHING/ADJUSTING APPARATUS AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: 光ビーム切替調整装置及びその製造方法



(57) Abstract: An optical waveguide substrate (2) has a groove (24) for receiving mirrors and optical waveguides. The optical waveguides guide the light input to an input port to an output port selected according to the advance/retreat of mirrors (31) into/from the groove (24). An actuator substrate (4) has the mirrors (31) and an actuator for setting the mirrors (31) at a retreated position to the substrate (4) and a protruding position from the substrate (4). The optical waveguide substrate (2) and the actuator substrate (4) are positioned by utilizing an alignment mark and connected to each other via a spacer (3) so that when the mirrors (31) retreat to the substrate (4), they retreat from the grooves (24) and when the mirrors (31) protrude from the substrate (4), they advances into the grooves (24). This positioning is performed with all the mirrors (31) in the retreated state to the substrate (4).



- (74) 代理人: 細江 利昭 (HOSOE,Toshiaki); 〒221-0822 神奈川県 横浜市 神奈川区西神奈川一丁目 3番 6号 コーポフジ 6 0 5 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,

AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

光導波路基板 2 は、ミラー受け入れ用の溝 2 4 と光導波路とを有する。 光導波路は、入力ポートに入力された光を、溝 2 4 に対するミラー 3 1 の進出及び退出に応じて選択された出力ポートに導く。アクチュエータ 基板 4 は、ミラー 3 1 と、ミラー 3 1 を基板 4 側に引っ込んだ状態と基 板 4 から突出した状態とにするアクチュエータを有する。ミラー 3 1 が 基板 4 側に引っ込んだときに溝 2 4 から退出するとともにミラー 3 1 が 基板 4 から突出したときに溝 2 4 内に進出するように、光導波路基板 2 とアクチュエータ基板 4 とが、アライメントマークを利用して位置合わ せして、スペーサ 3 を介して接合される。この位置合わせは、全てのミ ラー 3 1 を基板 4 側に引っ込んだ状態にして行われる。